

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут надірерських матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
 (найменування науково-дослідної установи)

Відділ N11

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА

з відрою високопродуктивна

(вказати форму підготовки)

1. Прізвище, ім'я по батькові Морігоро Алексій Петрович

2. Спеціальність (по якій проходить підготовка) 132 „матеріалознавство“

3. Дата зарахування в аспірантуру 01.11.2019

4. Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Лещук Олександр Олександрович
 (прізвище, ім'я по батькові, вчена ступінь і звання)

5. Тема дисертації "Вираження умов розчинності низької-високої
 (заповнюється після затвердження теми дисертації на Вченій раді з
високого риску при криогенізації" Стан 1/

указаним номеру та дати протоколу)

холодильно-розливальної системи Fe-Ga-N"

N15 від 02.02.2020 р. - протокол N1 від 30.01.2020 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вибору теми дисертаційної роботи аспіранта Людвіченка Олексія Петровича
«Визначення умов резистивного нагрівання комірки високого тиску для кристалізації GaN із розчин-розплавної системи Fe–Ga–N» за спеціальністю 132 – Матеріалознавство

Нітрид галію – це широкосмуговий напівпровідник, що в теперішній час має зростаюче технологічне застосування. Так, в 2014 р. за винайд ефективних блакитних світлодіодів на основі GaN, що привели до появи яскравих та енергозберігаючих білих джерел світла, присуджено Нобелівську премію з фізики. Виготовлення таких світлодіодів потребує наявності монокристалічних підкладок з GaN для їх епітаксіального нарощування.

Створення ефективного способу кристалізації GaN є актуальним питанням, оскільки його фізичні властивості значною мірою визначаються виникненням різних дефектів. Серед методів вирощування GaN відома гідридна парофазна епітаксія, що дозволяє кристалізувати GaN при атмосферному тиску та температурі 1000 °C зі швидкістю біля 100 мкм/год. Недосконалістю цього методу є висока дефектність вирощених кристалів, що виникає внаслідок залишкового напруженого-деформованого стану як в кристалах, так і в підкладках, на яких вони зростають.

Іншим методом вирощування кристалів GaN є амонотермія з використанням надкритичного аміаку (NH_3) як розчинника для GaN при тиску 0,2–0,3 ГПа та температурі 600–800 °C. Серйозним недоліком цього методу є надзвичайно низька швидкість росту (1–2 мкм/год) та відносно низька чистота вирощених кристалів.

Перші високоякісні кристали GaN, які можуть бути використані для епітаксіального нарощування та виготовлення процесорних пристройів, були отримані при температурі 1500 °C і тиску азоту 1 ГПа в газостатичній установці в Інституті фізики високих тисків Польської академії наук.

Новим підходом в отриманні нітриду галію при високих тисках (~ 6 ГПа) і температурах (~ 1800 °C) є його спонтанна кристалізація в багатокомпонентній розчин-розплавній системі Fe–Ga–N, що було продемонстровано в останні роки в дослідженнях відділу № 1 нашого інституту з використанням АВТ типу «тороїд». В результаті таких досліджень синтезовано ряд кристалів GaN розміром до 50 мкм.

Основною проблемою при розробці комірок є конструювання схеми резистивного нагрівання, що забезпечує необхідний розподіл температури в кристалізаційному об'ємі. Експериментальне визначення необхідних форм, розмірів нагрівачів і елементів теплоізоляції надзвичайно трудомістке. В цьому випадку доречно застосовувати методи комп'ютерного моделювання. Використовуючи сучасні обчислювальні методики, можна достатньо детально аналізувати процес резистивного нагрівання комірки для створення в ній ефективних умов кристалізації GaN з урахуванням:

РОБОЧИЙ ПЛАН 1 РОКУ ПІДГОТОВКИ

Найменування роботи	Об'єм і короткий зміст роботи
I. Підготовка та складання кандидатських іспитів	Підготовка і складання кандидатських іспитів з філософії та англійської мови.
II. Робота над дисертацією	
1. Теоретична	Проекти міжфахівчий огляд публікацій, способом отримання креативного підходу залишо. Вивчення пакетів програм AUTOCAD та ANSYS
2. Експериментальна робота	Проекти розрахунков тестових зразків по визначення розподілу геодіагностичних показів в АВТ типу "горід". При інтерпретації підходу залишо.
3. Публікація статей	Підготувати для публікації 7-8 реферів і одну статтю.

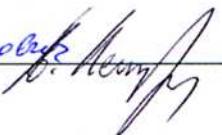
Аспірант Мартіненко Олександр Ростиславович 10 «квітня» 2020
Науковий керівник Леніук Олександр Олександрович 10 «квітня» 2020

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор _____
« » _____

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Найменування роботи	Об'єм і короткий зміст роботи	Строк виконання і форма звітності (дата. оцінка)
1. Підготовка і складання Кандидатських іспитів	1. Філософія	2 кв 2020р
	2. Іноземна мова	3 кв 2019р
	3. Спецдисципліна	1 кв 2022р
2. Робота над дисертацією	1. Теоретична робота	2019 - 2022 рр.
	2. Експериментальна робота	2019 - 2022 р.р.
	3. Оформлення дисертації	3-4 кв. 2023 р.р.

Аспірант Морозенко Олександр Петрович «10» листопада 2020

Науковий керівник Лензук Олександр Олександрович  «10» листопада 2020

РОБОЧИЙ ПЛАН 1 РОКУ ПІДГОТОВКИ

Найменування роботи	Об'єм і короткий зміст роботи
I. Підготовка та складання кандидатських іспитів	Підготовка і складання кандидатських іспитів з філософії та англійської мови.
II. Робота над дисертацією	
1. Теоретична	Проекти лінієвих та криволінійних структур, способи отримання кристалічного шару залишку. Використання пакетів програм AutoCAD та ANSYS
2. Експериментальна робота	Проекти розрахунків тестових зразків по визначення розподілу геоділягурних полів в АВТ та у гороїді при кристалізації шару залишку.
3. Публікація статей	Підготовка для публікації тез розробок і одночасно.

Аспірант Логішевський Олександр Ростиславович студ «10» лютого 2020

Науковий керівник Маслук Олександр Олександрович студ «10» лютого 2020

Срок виконання і форма звітності	Відмітка про виконання, оцінка чи висновок відділу чи наукового керівника
<p>Період складання категорій-секунд іспитів з астрономії мови і філософії 2020 р. Форма звітності - висновок про результати складання іспитів</p>	
<p>1-4 квартал 2020 р. Фізик і георадіоактивні речовини</p>	
<p>2-4 квартал 2020 р. Звіт про етапи місячного розвитку</p>	
<p>?-4 квартал</p>	

Атестація аспіранта науковим керівником _____

Рішення атестаційної комісії _____

Атестацію затверджую: Директор _____ « » _____